

フルラインナップでSiウェーハをカバー デバイス向けは液浸の立ち上がりに期待

2007年5月期は増収減益に

レイテックスは7月、2007年5月期の決算を発表した。売上高は前年比22.7%増の59億8000万円、当期利益は同35.3%減の6723万円となった。製品別では、ウェーハ検査装置が同6.6%減の34億3137万円、ウェーハ測定装置が同243.5%増の15億5270万円、商品・その他が同32.7%増の9億9602万円となった。ウェーハ検査装置は、国内Siウェーハメーカーの設備投資が引き続き堅調に推移し、国内外の工場で300mmウェーハ用検査装置の導入が積極的に実施された。しかし、一部案件で納入がずれ込んだものもあったため、わずかだがマイナスとなった。ウェーハ測定装置に関しては、従来製品に加えて、Siウェーハメーカー向けへの「NanoPro NP2」の出荷が本格化したことなどから、大幅な伸びとなった。商品・その他については、米Thema Waveの薄膜測定装置およびイオンドーズモニタの販売が好調だった。

売上は好調で、営業利益も増加したが、当期利益は減少し、増収減益となった。この理由としては、開発中の新機種で、追加仕様などにより開発費が増大した他、それに伴う納入時期のずれ込みなどがある。

2008年5月期の売上高は前年比18.8%増を見込む

2007年5月期の主なトピックスとしては、ナノシステムソリューションズ(NSS)の子会社化やウェーハ内部欠陥検査装置事業の買収などがある。NSSは独自のテレセントリック光学系をコア技術に持つベンチャー企業で、以前よりレイテックスの装置や技術の開発を手掛けていた。今回、完全子会社化したことで、開発効率の向上など、シナジー効果に期待している。

ウェーハ内部欠陥検査装置事業は三井金属から買収したもので、Siウェーハの表面異物や粗れ、表層近傍の欠陥などを識別・検査するLSTDスキャナ「MO-601」、Siウェーハ内部の欠陥密度を測定するBMDアナライザ「MO-441」がある。ウェーハ内部欠陥検査装置が加わったことで、Siウェーハの検査および測定に関しては、ほぼフルラインナップが揃ったことになり、さらなる拡販を狙う。

この他、デバイス製造プロセスもいよいよ本格化してくる模様だ。デバイス製造プロセス向けでは、すでにCuプロセスにおけるエッジポリッシングや

CMP後の検査には同社のデバイスプロセス向けエッジ検査装置が用いられている。しかし、これらは工程数が少ないため、導入される装置も少ない。このため、現在は液浸リソグラフィにフォーカスして展開している。リソグラフィは工程数も多いことから、本格的に導入されれば多くの台数が必要になる。半導体メーカーや露光装置メーカーなどがエッジ検査装置を導入し、液浸プロセスの研究開発用に使用している。液浸リソグラフィでは、エッジやベベル



代表取締役社長 高村 淳氏

ルの管理が従来以上に重要になると見られているため、大手半導体メーカーの大部分がすでに導入済みという。液浸リソグラフィの本格量産は、当初予測より若干遅れ気味だが、2007年末から2008年には本格化していくと見ている。

2008年5月期に関しては、Siウェーハメーカーの300mmウェーハの増産投資が継続しており、ウェーハ検査・測定装置は売上増を見込んでいる。デバイス製造プロセス向けも本格化が期待できる。このため、売上高は前年比18.8%増の68億9800万円、当期利益は同118.1%増の2億7000万円を計画している。